

半導体関連製品

シリコン鏡面ウェーハ用超高純度アルカリ洗浄液

ANC-1

はじめに

弊社の超高純度アルカリ洗浄液 "ANC-1" は、シリコンウェーハ製造における鏡面 ウェーハの洗浄や半導体デバイス工場でのウェーハプロセスにおける洗浄において、優れた洗浄効果を有する超高純度な洗浄液です。

特徴

Na, K 等のアルカリ金属や、他の重金属をほとんど含まない超高純度洗浄液です。また、陰イオン不純物も含まれておりません。この為、基板に対する汚染がないことはもちろん、洗浄液の温度を上げて使用した場合でも、Na, Cl によるクリーンルームの汚染が全くありません。

- ・ ANC-1 の分析結果を以下に示します。
(尚、以下の値は Typical Properties であり Specifications ではありません。)

洗浄液 (原液)	金属不純物 (ppb)					
	Na	K	Fe	Al	Cu	Ca
ANC-1	1.2	1.0	1.1	0.3	0.2	0.4

上記の結果は、ANC-1 の原液での結果です。

実際の使用に際しては、超純水にて 30 倍程度に希釈しての使用になりますので、洗浄液中の金属不純物は、超純水と同レベルになるものと思われます。

広範囲の複合汚染に対して、優れた洗浄効果を示す為、通常のプロセスでは、ANC-1 だけの洗浄に簡略化できます。ANC-1 は、有機汚染を除き、かつ弱いエッチング作用を有し、重金属汚染に対しても強力な除去効果を示します。

シリコンウェーハに付着したワックスに対しても十分な除去作用がありますので、トリクロルエチレン等の毒性の強い溶剤を使用しない洗浄が可能となります。

化学組成が安定で、においが無い為、加熱処理がやすく、適切な洗浄濃度、洗浄時間、洗浄温度のコントロールにより安定した洗浄効果、エッチングレートが得られます。

20 ~ 30 倍の希釈液で、十分な洗浄効果が得られる為、経済的であり、一括洗浄方式による効率的な洗浄により 薬品、純水の使用量削減が可能です。

使用方法

洗浄目的に応じ、ANC-1 を 20 ~ 30 倍に純水で希釈して 60 ~ 80°C 程度に加熱し、10 分間前後 洗浄してください。尚、超音波洗浄器を併用すると一層洗浄効果があります。希釈タイプですのでコスト的にメリットがあります。

取扱い上の注意

本品は、強アルカリ性である為、ゴム手袋や保護眼鏡などの保護具を着用して、皮膚には直接触れない様にしてください。

誤って皮膚、目に触れた場合は、直ちに多量の流水で洗浄してください。

本品の保存に際しては、専用の容器に密閉して室温で保管してください。

使用前には、MSDS を参照してください。